

2010年5月13日

各位

日本ゼオン株式会社

日本ゼオンとIBM、半導体エッチング技術における共同開発を発表

日本ゼオン株式会社(社長:古河直純)は、International Business Machines Corporation (NYSE:IBM)との間で、22nm 及びそれ以降の世代における FEOL (Front-End-Of-Line) 向け新規エッチングガスの共同研究開発に合意したと発表した。本件は IBM と日本ゼオン株式会社との間における初めての共同研究開発となる。

IC チップの高集積化が進むにつれ、これまでのようにムーアの法則を維持することが困難になってきているが、IBM と日本ゼオン株式会社双方の技術者が共同して研究開発に取り組むことにより、次世代半導体デバイスが抱える様々な技術課題に対するソリューション提案が可能になると期待される。日本ゼオンは技術者を米国ニューヨーク州の Yorktown Heights にある IBM の Thomas J. Watson 研究所に派遣し、そこで共同開発を進めることになる。

「IBM に蓄積された様々な技術及び産業における革新性と、日本ゼオンの独創的な化学合成技術とを融合することで、直面する数々の技術課題の解決が期待でき、両社に大きな相乗効果をもたらすことが可能であると考えています。」と、日本ゼオン株式会社社長の古河直純はコメントした。

「IBM との協業により、技術的に一歩踏み込んだフィードバックを得ることで、これまで以上に新規エッチングガスの開発期間を短縮することが可能になると期待しております。また、IBM は半導体開発において業界の技術的なリーダーシップを取ってきたことや、これまで多くのパートナー企業との協業により、数多くの成功を収めてきた歴史を高く評価しています。」と古河社長は続けてコメントした。

日本ゼオン株式会社は、これまで長年にわたり商品名 ZEORORA® ZFL-58 の C5F8 ガスを含めた、C5 系フロロカーボンガスを開発してきた。日本、米国、英国に研究所を持ち、米国ケンタッキー州のルイビルおよびドイツのデュッセルドルフに各地域の拠点があります。

IBM についての詳細は <http://www.ibm.com> をご覧ください。

以上

日本ゼオン株式会社
CSR 統括部門 広報室
電話 03-3216-2747

The logo for ZEON, consisting of the word "ZEON" in a bold, blue, sans-serif font.